

عنوان مقاله:

مروری بر طیف سنجی فوتوالکترون پرتو X (XPS) و کاربردهای آن

محل انتشار:

سومین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی (سال: 1401)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

فرخ فر ولیزاده هرزند - دانشگاه محقق اردبیلی

علی نعمت اله زاده - دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:

طیف سنجی فوتوالکترون پرتو X (XPS) به یکی از پرکاربردترین تکنیکهای آنالیز سطح تبدیل شده است. XPS یا طیف سنجی الکترونی برای تجزیه و تحلیل شیمیایی با قابلیت به دست آوردن ترکیب عنصری کمی، حالت شیمیایی و اطلاعات ضخامت لایه پوششی از بالای ۱۰ نانومتر از سطح نمونه، یک روش همپکاره و گسترده است. در این مقاله مروری، اصول اولیه این تکنیک از جمله اثر فوتوالکترونیک، چگونگی برهمکنش الکترونها با ماده، عوامل موثر در این تکنیک مانند آلودگی سطحی، و اثر محیط شیمیایی اطراف یک عنصر بر انرژی اتصال الکترونها خود ارائه شده است. همچنین کاربردها و روشکار این تکنیک مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی:

طیف سنجی فوتوالکترون پرتو X (XPS): الکترون اوژه؛ آنالیز عنصری؛ پرتو X

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1549759>

